

ミクロンサイズの“つくる”を支えます

～先端ICTデバイス研究開発推進センターの活動～

概要

先端ICTデバイス研究開発推進センターは、持続可能な社会構造の構築を目指し、産学官連携によるデバイス研究を推進するオープンイノベーション拠点です。

ミクロンサイズの加工技術を活用し最先端デバイスの基盤技術を創造しています。

電子線描画装置
レーザ描画装置
紫外線露光装置



ドライエッチング
ウエットエッチング
ポリッシング装置

えがく
リソグラフィ技術

けずる
エッチング技術

デバイス
研究開発

はかる
計測技術

つける
成膜技術

光・THz波計測装置
プロセス評価装置
高周波計測装置



電子ビーム蒸着装置
プラズマ化学気相堆積
スパッタリング装置



特徴

- ・ 特色ある4拠点でデバイス研究開発
 1. 光デバイス施設(本部)、
 2. 高周波電子デバイス施設(本部)
 3. フロンティアデバイス関連施設(神戸)、
 4. デバイス協創施設(神戸)
- ・ 光・超高周波デバイス・超伝導デバイス等の開発
- ・ 開発デバイスの高精度評価が可能な環境を準備
- ・ 環境に配慮した研究開発環境*の提供
 - * 環境ISO14001認定取得(本部)

外部利用制度の利用形態

- ・ NICT研究者との共同研究型
- ・ NICT委託研究推進型
- ・ 開発成果を提供いただく研究連携型
- ・ 自由度の高い成果活用・施設等供用型

今後の展開

- ・ デバイス加工工程の高精度化
- ・ 標準デバイス作製メニューの提供
- ・ 計測、評価手法の提供